

(付録)

半導体技術ロードマップ専門委員会 外部発表リスト

(平成20年度実績)

(1) 2008 年 4 月

発表形態 : 執筆
掲載日 : 平成 20 年(2008 年) 4 月
執筆者 : 長田 俊彦 (STRJ 副委員長)
タイトル : 「ITRS 2007 (国際半導体技術ロードマップ 2007 年全面書き下ろし版)の概要」
掲載誌名 : SEAJ 5 月号
刊行団体名 : SEAJ

(2) 2008 年 4 月

発表形態 : 講演
講演日 : 平成20年(2008年) 4月16日
講演者 : 津金 賢、白水好美、清田久晴、西萩一夫 (WG11)
講演タイトル : 「今後の半導体製造に求められるクリーンルーム環境(ITRS2007 におけるウェハ環境制御の技術的要求と課題)」
講演会名称 : 第 26 回空気清浄とコンタミネーションコントロール研究大会
主催団体名 : 社団法人 日本空気清浄協会

(3)2008 年 5 月

発表形態 : 講演
講演日 : 平成20年(2008年) 5月26日
講演者 : 栗野 祐二 (WG14)
講演タイトル : 「新材料でエレクトロニクスを変革する」
講演会名称 : 自動車会館(市ヶ谷)
主催団体名 : 株式会社サイエンスフォーラム

(4)2008 年 6 月

発表形態 : 講演
講演日 : 平成20年(2008年) 6月19日
講演者 : 栗野 祐二 (WG14)
講演タイトル : 「新材料でエレクトロニクスを変革する」
講演会名称 : SEMI Forum Japan 2008(大阪)
主催団体名 : SEMI ジャパン

(5)2008 年 6 月

発表形態 : 講演
講演日 : 平成20年(2008年) 6月25日
講演者 : 山崎 治 (WG4)
講演タイトル : 「超臨界流体を用いた超トポグラフィック・ナノ Cu 配線形成プロセスの開発と実用化指針検討」

講演会名称 : 2007 年度 STARC 研究成果報告会
講演場所 : STARC内会議室
主催団体名 : (株)半導体理工学研究センター(STARC)

(6)2008 年 7 月

発表形態 : 講演
講演日 : 平成20年(2008年) 7月11日
講演者 : 佐藤 成生 (青木委員が代理発表) (WG10)
講演タイトル : 「半導体ロードマップにおけるModeling & Simulationの活動」
講演会名称 : 応用物理学会シリコンテクノロジー分科会 モデリング研究委員会
講演場所 : 機械振興会館 B3階 研修-1
主催団体名 : 応用物理学会

(7) 2008 年 8 月

発表形態 : 執筆
掲載日 : 平成20年(2008年) 8月
執筆者 : 津金 賢 (WG11)
タイトル : 「ウェーハ環境汚染制御における改定のポイント」
掲載誌名 : クリーンテクノロジー8月号
主催団体名 : 日本工業出版(株)

(8) 2008 年 8 月

発表形態 : 講演
講演日 : 平成20年(2008年) 8月26日
講演者 : 石内 秀美(委員長)
講演タイトル : 「半導体集積回路のロードマップ 国際半導体技術ロードマップ(ITRS)の紹介」
講演会名称 : TSC プロセス・デバイス専門研修(Selete インターンシップ講義研修)
講演場所 : Selete連携棟1階会議室(つくば)
主催団体名 : 株式会社 半導体先端テクノロジーズ(Selete)

(9) 2008 年 9 月

発表形態 : 執筆
掲載日 : 平成20年(2008年) 9月
執筆者 : 津金 賢、白水好美、清田久晴、西萩一夫(WG11-WECC)
タイトル : 「ITRS2007 におけるウェーハ環境制御の技術的要求」 津金
「半導体プロセスへの分子汚染の影響」 白水
「製造装置・搬送環境の分子汚染制御」 清田
「汚染計測の現状と課題」 西萩
掲載誌名 : 空気清浄 第 46 巻 第 3 号(2008)
主催団体名 : 社団法人 日本空気清浄協会

(10) 2008 年 11 月

発表形態 : 講演
講演日 : 平成20年(2008年) 11月27日
講演者 : 浅田 善己 (WG1)
講演タイトル : 「微細化に伴う低電力設計上の課題」
講演会名称 : STARCアドバンスト教育講座 「SoC製品事例研究セミナー」
講演場所 : 新横浜国際ホテル (各企業サイト等に中継)
主催団体名 : (株)半導体理工学研究センター(STARC)

(11) 2009 年 1 月

発表形態 : 講演
講演日 : 平成21年(2009年) 1月21日
講演者 : 東川 巖 (WG5)
講演タイトル : 「リソグラフィ技術のロードマップと現状」
講演会名称 : 第18回光反応・電子用材料研究会講座
講演場所 : 東京工業大学フェライト会議室
主催団体名 : 高分子学会 光反応・電子用材料研究会

(12) 2009 年 3 月

発表形態 : 執筆
掲載日 : 平成21年(2009年) 3月25日
執筆者 : 伊藤 修一(WG2)
タイトル : 「メモリ混載LSIテスト技術」
掲載誌名 : 2009 半導体テクノロジー大全
刊行団体名 : 株式会社 電子ジャーナル